• Вблизи резонанса, когда  $\omega \approx kc \approx (k+k_0)v_z$ , получим из (4) уравнение  $v^6 + v^5 + B = 0$ .

лде

$$B = \frac{2\omega^4 \omega_{p0}^2 a^6 \beta_{\perp}^2}{\gamma \gamma_z^2 c^6}$$

Из шести корней уравнения (5) физически значимым оказывается только один, у которого  $v_1>0$ ;  $v_2<0$  (рисунок). Отметим, что  $v\simeq B^{1/6}$  ( $\sqrt[7]{3/2}-i/2$ ) при больших B.



В зависимости от величины параметра B можно качественно выделить три случая: 0 < B < 1 слабая канализация излучения (значительная часть светового пучка сосредоточена вне электронного); 1 < B < 1000 — умеренная канализация (излучение сосредоточено в основном в электронном нучке); B > 1000 — сильная канализация (излучение основной моды сосредоточено вблизя оси электронного пучка, однако происходит генерация и высших мод). Инкремент неустойчивости волны излучения, характеризующий коэффициент усиления, при сильной канализации практически совпадает с рассчитанным по одномерной теории и значительно меньше при слабой канализации.

Приведем оценку для *B* в завнеимости от основных параметров ЛСЭ. В типичных экспериментах  $\beta \perp \sim 1/\gamma$ ;  $\gamma_{z}^{2} \sim \gamma^{2}/2$ . Пусть величина  $4a^{2}$  — порядка поперечного сечения пучка. Тогда  $I \sim 4a^{2}enc$  — характерный ток пучка. В этом случае  $B \sim I(a/l)^{4}\gamma^{3}$ , где I — ток в амперах. Таким образом, канализация излучения может быть обеспечена как в СВЧ днапазоне при значительном токе и умеренных  $\gamma$ , так и в оптическом дианазоне при умеренном токе и больших  $\gamma$ .

В заключение автор считает своим приятным долгом поблагодарить А. А. Коломенского и И. И. Пахомова за обсуждение результатов работы.

## . СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Генераторы когерентного излучения на свободных электронах/Под ред. А. А. Рухадзе. М., 1983. [2] Мооге G. Т.//Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. 1985. **А239**. Р. 19. [3] Sharlemann E. T., Sessler A. M., Wurtele J. S.//Ibid. Р. 29. [4] Афонин А. М., Канавец В. И., Черепенин В. А.//Радиотехн. и электроянка. 1980. 25. С. 1945. [5] Коломенский А. А., Пахомов И. И.//Физ. плазмы. 1984. 10. С. 1275. [6] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. М., 1963.

Поступила в редакцию 23.09.87

(5)

## ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1988. Т. 29, № 3

## ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

УДК 538.221

## О МЕХАНИЗМЕ НЕОДНОРОДНОГО ВРАЩЕНИЯ В ПЛЕНКАХ ФЕРРИТОВ-ГРАНАТОВ

### Д. И. Йоргов (Болгария), О. С. Колотов, В. А. Погожев

(кафедра общей физики для физического факультета)

### Исследуется поведение намагниченности при импульсном перемагничивании пленок ферритов-гранатов в однородных полях в области неоднородного вращения. Приводятся магнитооптические фотографии динамических доменов.

Основным механизмом 180°-го импульсного перемагничивания магнетиков в сильных полях является механизм неоднородного вращения [1-7]. Изучение природы этого механизма в различных магнетиках связано с обнаружением новых неравновесных

94

доменных конфигураций и поэтому важно для развития магнетодинамики. Рассматриваемая задача представляет и практический интерес. Так, для повышения быстродействия магнитооптических модуляторов на пленках ферритов-гранатов (ΠΦΓ) желательно вместо смещения доменных границ использовать более быстрые механизмы перемагничивания. К настоящему времени более или менее детально механизм неоднородного вращения изучен только в пермаллоевых пленках [2]. Что касается ПФГ .[3-7], то накопленные сведения фрагментарны, получены зачастую при использова-



Рис. 1. Магнитооптические фотографии динамических доменных структур, полученные для различных моментов времени t после начала перемагничивания в поле  $H_n = 1.98$  кЭ: t = -30 (a), 7 (б), 11 (в), 22 (г), 32 (д) и 52 нс (е)

нии пространственно неоднородного поля и носят противоречивый характер. Так, в •одних работах поведение намагниченности связывается с «турбулентным зарождением микродоменов» [3, 5, 6], в других — с вращением намагниченности, однородным по площади пленки, но неоднородным по ее толщине [7].

В данной работе приводятся сведения о поведении намагниченности в процессе неоднородного вращения при импульсном перемагничивании пленок в однородном поле. Исследования выполнены на магнитооптической установке [8], позволяющей наблюдать динамические домены и исследовать поведение суммарной намагниченности перемагничиваемых образцов. Время нарастания поля не превышало 8 нс, длительность светового импульса была близка к 6 нс. Неоднородность поля в объеме исследуемого участка пленки (диаметром до 2 мм) не превышала 3%.

Здесь приводятся результаты исследования пленки толщиной 33 мкм состава (BiYLu)<sub>3</sub>(FeGa)<sub>5</sub>O<sub>12</sub> с эффективным полем одноосной анизотропии  $H_{\rm R} = (2,05\pm0,06)$  кЭ, намагниченностью насыщения  $M_s = 8$  Гс, шириной равновесных полосовых доменов 24 мкм, полем коллапса 60 Э и полем перехода к механизму неоднородного вращения  $H_0 = 1,92\pm0,06$  кЭ. Исходное состояние пленки задавалось с помощью постоянного поля  $H_{\rm cM} = 90$  Э. Импульсное поле  $H_{\rm m}$  было направлено противоположно полю  $H_{\rm cM}$ . Регистрация динамических доменов проводилась при скрещенных поляри-заторе и анализаторе (методом фазового контраста).

На рис. 1 приведены фотографии доменных образований, возникающих при перемагничивании в поле  $H_{\pi} = H_{\mu} - H_{cM} = 1,98$  кЭ. На рис. 2 показаны соответствующие этому режиму магнитооптические сигналы, полученные при использовании фазового (кривая 1) и амплитудного (кривая 2) контрастов. Исходному (рис. 1, а) (и конечному) состоянию пленки при фазовом контрасте

Исходному (рис. 1, а) (и конечному) состоянию пленки при фазовом контрасте соответствует наибольшая яркость изображения. Рис. 1, б отражает состояние пленки примерно через 7 нс после начала перемагничивания. Этот момент времени приходится на начальные участки с быстрым изменением напряжения сигналов (рис. 2, кри-



напряжения сплалов (рис. 2, кри вые 1 и 2). Видно заметное потемнение изображения. Следующий кадр (рис. 1,  $\beta$ ) получен для момента времени  $t^* \approx 11$  нс, примерно совпадающего с окончанием начальных участков на сигналах. Напряжение сигнала, полученного при фазовом контрасте, при этом близко к минимуму. Рассматриваемые изменения магнитооптиза время ~11 нс. Если же учесть конечное

Рис. 2. Магнитооптические сигналы, полученные при импульсном перемагничивании пленки в поле  $H_{\rm H}$ =1,98 кЭ при использовании фазового (1) и амплитудного (2) контрастов. Частота калибрацнонного сигнала 50 МГц. Буквы *a*, *б*, ... соответствуют моментам времени, для которых получены приведенные на рис. 1 фотографии

время установления поля и конечную длительность светового импульса, то собственное время начального изменения намагниченности будет существенно меньше. Отсюда следует, что это изменение может быть вызвано только вращением намагниченности.

Очевидно, что при 180°-м перемагничивании направления вращения намагниченности в отдельных участках пленки должны отличаться. Из рис. 1, в и г следует, что отличаются и абсолютные значения скорости вращения. Об этом свидетельствует появление светлых и темных мест. Таким образом, нельзя утверждать, что в полях  $H_{\pi} > H_0$  вращение намагниченности происходит однородно по поверхности пленки.

Доменные структуры, наблюдаемые для моментов времени  $t \ge t^*$ , имеют форму неправильных темных и светлых полос. Анализ показывает, что в светлых полосах намагниченность в основном ориентирована по полю  $H_n$ . Что касается темных полос. то здесь однозначная интерпретация пока затруднительна. Скорее всего из-за неоднородности параметров пленки вращение намагниченности неоднородно не только по поверхности, но и по толщине. Возможно также, что к моменту времени  $t^*$  начальное вращение существенно замедляется и дальнейшее изменение намагниченности связано с движением неравновесных (в том числе и горизонтальных [6, 7]) границ, окружающих еще неперемагниченные локальные микрообъемы пленки. Как видно из рис. 1  $\theta-e$ , это приводит к уменьшению размеров доменных образований с отстающей намагниченностью, сопровождаемому постепенным просветлением их изображений. Этой стадии перемагничивания соответствуют участки с медленным изменением напряжения сигналов.

Предварительные результаты показывают, что средняя ширина полос уменьшается (от  $\sim 10 \div 15$  мкм до  $\sim 2 \div 3$  мкм) с уменьшением толщины пленок. Опыт показывает также, что ориентация полос изменяется по поверхности пленки. Для некоторых пленок с толщиной не более 10 мкм наблюдаемая доменная структура имеет вид лабиринтов.

Участки сигналов с быстрым изменением напряжения впервые появляются в поле  $H_{\pi} \approx H_0$ . С ростом  $H_{\pi}$  напряжение сигнала  $e^*$  (при использовании амплитудного контраста) в момент времени  $l^*$  быстро увеличивается. Так, для данной пленки уже в поле  $H_{\pi} = H_1 = 2,1$  кЭ величина  $e^*$  практически равна амплитуде сигнала, а время перемагничивания уменьшается до 10 или менее наносекунд. Таким образом, в полях  $H_{\pi} > H_1$  практически все изменение намагниченности обусловлено процессами вращения, не сменяемыми, как то было рассмотрено выше, более медленными процессами. Итак, в полях  $H_{\pi} > H_1$ , по-видимому, имеет место механизм «истинного» неоднородного вращения требует существенного увеличения временной разрешающей способности существующих установок.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Нитрhrey F. B., Gyorgy E. М.//J. Аррl. Phys. 1959. 30. Р. 935. [2] Колотов О. С., Мусаев Т. Ш., Погожев В. А., Телеснин Р. В.//ФММ. 1978. 46. С. 1182. [3] Иванов Л. П., Логгинов А. С., Непокойчицкий Г. А.// //ЖЭТФ. 1983. 84. С. 1006. [4] Колотов О. С., Куделькин Н. Н., Погожев В. А., Телеснин Р. В.//ЖТФ. 1985. 55. С. 761. [5] Логунов М. В., Рандошкин В. В.//ЖТФ. 1985. 55. С. 1194. [6] Дудоров В. Н., Логунов М. В., Рандошкин В. В.//ФТТ. 1986. 28. С. 1549. [7] Логунов М. В., Рандошкин В. В.//ФТТ. 1986. 28. С. 1559. [8] Колотов О. С., Погожев В. А., Телеснин Р. В.//Приб. и техн. эксперимента. 1986. № 1. С. 182.

Поступила в редакцию-05.06.87

ВЕСТН. МОСК, УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ. 1988. Т. 29, № 3

УДК 621.315.592

О ПРИРОДЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГАШЕНИЯ ФОТОПРОВОДИМОСТИ В a-Si: H

И. А. Курова, Н. Н. Ормонт, О. Е. Коробов, А. Н. Лупачева

(кафедра физики полупроводников)

Приведены экспериментальные данные по зависимости фотопроводимости пленок a-Si: Н от температуры, напряженности электрического поля и температуры предварительного освещения. Данные интерпретируются с помощью модели, основанной на представлении о существовании случайного потенциального рельефа.

Известно, что в нелегированных пленках a-Si: Н наблюдается температурное гашение фотопроводимости (ТГФ) [1-6]. При облучении белым светом или электронами при комнатной температуре фотопроводимость (ФП) в этих пленках падает и температурное гашение исчезает. Для объяснения в [3] была предложена модель, которая связывала ТГФ с увеличением темпа рекомбинации электрона, захваченного на оборванную связь D-, и дырки, захваченной в хвост состояний валентной зоны в результате термически активированного переноса дырки к D<sup>-</sup>. При увеличении концентрации оборванных связей после облучения светом при комнатной температуре или электронами ФП падает, термическая активация переноса дырок становится не эффективной в увеличении рекомбинации и ТГФ исчезает. В процессе отжига при 170° С фотояндуцированные оборванные связи отжигаются, пленка восстанавливает свои свойства и ТГФ вновь наблюдается. В [7] показано, что облучение нелегированных пленок a-Si: Н белым светом при низких температурах образует фотоиндуцированные дефекты, отличающиеся по свойствам от оборванных связей. Эти дефекты мало влияют на поглощение света в области 1,2 эВ, соответствующее поглощению на оборванных связях. В то же время облучение при низких температурах уменьшает величину ТГФ.

В настоящей работе исследовалось изменение величины и температурной зависимости ФП пленки после ее предварительного облучения при низких температурах. На рис. 1 показана температурная зависимость ФП после отжига пленки при 170°С в течение 45 мин (1), после освещения белым светом при комнатной (2) и низкой (3) температурах. Видно, что после предварительного освещения пленки как при комнатной, так и при низкой температуре ФП пленки падает и ТГФ подавляется, но температурная зависимость ФП различна.

На рис. 2 показаны температурные зависимости ФП пленки  $\sigma(T)$ , предварительно облученной светом при низкой температуре ( $T_0 = 180$  К) и после охлаждения нагретой до разных значений температуры T'. Для всех  $T' < T_0 \sigma(T)$  практически не изменяется при многократном охлаждении и нагревании до T' (кривая 3). Если  $T' = T_2' > T_0$ , то ход изменения ФП при последующем охлаждении и повторном нагревании до  $T_2'$  и выше (кривая 2) отличается от первоначального хода  $\sigma(T)$  (кривая 3) и определяется значением T'. При этом, как видно, возможно частичное восстановление ТГФ. Таким образом, образец «помнит», до какой максимальной температуры T' он был нагрет.

На рис. З приведены температурные зависимости ФП пленки, отожженной и облученной при низкой (T = 100 K) и комнатной температурах, измеренной в разных